(f) Int. Cl.⁷:

G 21 K 1/06

199 45 773

BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



PATENT- UND **MARKENAMT**

- Offenlegungsschrift
 - DE 199 45 773 A 1
- (2) Aktenzeichen:

199 45 773.5

- (22) Anmeldetag:
- 24. 9. 1999
- (43) Offenlegungstag:
- 12. 4. 2001
 - (12) Erfinder:

Schubert, Dirk W., Dr., 21502 Geesthacht, DE; Pannek, Michael, 21502 Geesthacht, DE

66 Entgegenhaltungen:

DE 44 02 113 A1 DE-40 15 275 A1

WO 96 37 898 A1

(1) Anmelder:

GKSS-Forschungszentrum Geesthacht GmbH, 21502 Geesthacht, DE

(14) Vertreter:

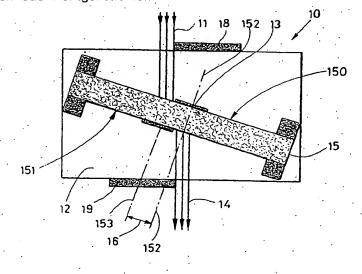
Niedmers & Seemann, 22767 Hamburg

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Worrichtung zum Monochromatisieren von Neutronen- oder Röntgenstrahlen

Vorrichtung (10) zum Monochromatisieren von Neutronen- oder Röntgenstrahlen (11), umfassend wenigstens einen Monochromatorkristall (12), auf den die Neutronenoder Röntgenstrahlen (11) gerichtet und nach der daran erfolgenden Reflexion als monochromatisierte Neutronen- und Röntgenstrahlen (14) abgegeben werden. Dabei ist der Monochromatorkristall (12; 13) auf der Oberfläche (150; 151) eines planparallelen, für Neutronen- oder Röntgenstrahlen (11, 14) durchlässigen Trägerelementes (15) angeordnet.



Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Monochromatisieren von Neutronen- oder Röntgenstrahlen, umfassend wenigstens einen Monochromatorkristall, auf den die Neutronen- oder Röntgenstrahlen gerichtet und nach der daran erfolgenden Reflexion als monochromatisierte Neutronen- oder Röntgenstrahlen abgegeben werden.

Aus geeigneten Elementen bestehende Kristallelemente werden in den verschiedensten wissenschaftlichen und technischen Bereichen eingesetzt, um für bestimmte Untersuchungen Neutronen- und Röntgenstrahlen zu monochromatisieren. Vorrichtungen der eingangs genannten Art können beispielsweise in Neutronenreflektometern und Kleinwinkelneutronenstreuanlagen zum Einsatz kommen, um auf optimale Weise deren Betriebsmodus verändern zu können. Beispielsweise kann durch die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Kleinwinkelstreuapparatur optional auf einfache Weise derart in der Auflösung verbessert werden, daß Reflexionsexperimente mit hoher Auflösung möglich sind.

Bisher wurden Vorrichtungen dieser Art durch sehr aufwendige, feinmechanische Vorrichtungen realisiert, die wiederrum sehr aufwendige Justiereinrichtungen aufwiesen. Bei der Reflexion der Neutronen- und Röntgenstrahlen an dem Monochromatorkristall werden physikalisch die 25 Bragg-Reflexionsbedingungen von Neutronen- oder Röntgenstrahlen am Kristallgitter des Monochromatorkristalls für die Monochromatisierung ausgenutzt. Insofern müssen die Netzebenen der Kristalle hochgenau relativ zu den einfallenden Neutronen- und Röntgenstrahlen justiert werden. Die vorgenannten feinmechanischen Justiervorrichtungen, die dazu dienen, sind in der Herstellung nur sehr kostenträchtig realisierbar (Herstellungspreis > DM 10.000,--). Zudem sind die bekannten Vorrichtungen bzw. die Justiervorrichtungen der bekannten Vorrichtungen bisweilen auch 35 für die Untersuchung von Kleinwinkelstreuungen nicht in jedem Falle hinreichend genau und stabil, so daß dieser Nachteil sich zu den sehr hohen Herstellungskosten addiert. Zudem sind die bisherigen mechanischen Justiervorrichtungen auch empfindlich in bezug auf äußere Einwirkungen, 40. d. h. Erschütterungen, Umgebungstemperatur und Drucksowie Luftfeuchtigkeitsänderungen.

Es ist somit Rufgabe der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, mit der einerseits eine hochgenaue, weitgehend von Umgebungspa- 45 rametern unabhängige Monochromatisierung von Neutronen- und Röntgenstrahlen möglich ist, mit der zudem beispielsweise vorhandene Monochromatorkristalle einer erneuten Verwendung zugeführt werden können, die verhältnismäßig einfach aufgebaut ist und kostengünstig realisiert 50 werden kann.

Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung dadurch, daß der Monochromatorkristall auf der Oberfläche eines planparallelen, für Neutronen- oder Röntgenstrahlen durchlässigen Trägerelementes angeordnet ist.

Der Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung liegt darin, daß diese einen äußerst geringen Justieraufwand benötigt, da letztlich nur ein planparalleles, für Neutronenund Röntgenstrahlen durchlässiges Trägerelement erforderlich ist, auf dem der Monochromatorkristall auf dessen 60
Oberfläche angeordnet ist. Ein derartiges planparalleles, für Neutronen- und Röntgenstrahlen durchlässiges Trägerelement ist einfach beschaff- und somit bereitstellbar, wobei dabei auf durch die Industrie angebotene Halbzeuge aus geeigneten Werkstoffen zurückgegriffen werden kann.

Bei der Monochromatisierung von Neutronen- oder Röntgenstrahlen unter den Bedingungen der Bragg-Reflexion entstehen normalerweise große Ablenkwinkel. Derartige

große Ablenkwinkel sind in vielen Fällen nicht realisierbar und in vielen Fällen auch unerwünscht, wenn beispielsweise große experimentelle Aufbauten, wie sie normalerweise bei Neutronenstreuungsexperimenten zu erwarten sind, realisiert werden mußten. Aus diesem Grunde ist es äußerst vorteilhaft, auf beiden Oberflächen des Trägerelementes jeweils ein Monochromatorkristall anzuordnen, wobei beide Monochromatorkristalle, bezogen auf deren jeweils gedachte Oberflächennormalen, die im wesentlichen mittig auf den Monochromatorkristallen (gedacht) anzuordnen sind, voneinander beabstandet sind. Eine derartige vorzugsweise Ausgestaltung der Vorrichtung bildet faktisch einen sogenannten Doppelkristallmonochromator, um die einfallenden Neutronen- und Röntgenstrahlen wieder in ihre ursprünglich Richtung zu zwingen, allerdings mit einem Versatz, bedingt durch die zweifache Reflexion am ersten Monochromatorkristall und am zweiten Monochromatorkristall. Durch das planparallele Trägerelement sind die Monochromatorkristalle fortwährend parallel ausgerichtet, wobei das Trägerelement, wie oben schon angedeutet, so ausgewählt wird, daß Neutronen- und Röntgenstrahlen ohne signifikante Abschwächung durch das Trägerelement hindurchgehen kön-

Vorzugsweise besteht das Trägerelement aus einem Halbleiterwerkstoff, beispielsweise vorzugsweise aus Silizium bzw. vorzugsweise aus Germanium. Halbleiterwerkstoffe der voraufgeführten Art zeigen eine geringe Durchlaßdämpfung für Neutronen- und zumindest hochenergetische Röntgenstrahlen, die vernachlässigbar klein ist und bei Experimenten mit Neutronen- und zumindest hochenergetischen Röntgenstrahlen faktisch nicht signifikant in Erscheinung tritt. Zudem sind Halbleiterwerkstoffe zumindest in undotierter Form sehr kostengünstig bereitstellbar und werden in großen Mengen in der Halbleiterindustrie zur Herstellung von Wafern verwendet, aus denen dann elektronische Bauelemente wie integrierte Schaltkreise und dergleichen hergestellt werden.

Da somit planparallele scheibenförmige Elemente zur Ausbildung der erfindungsgemäß verwendeten Trägerelemente als Vorprodukte bzw. Halbzeuge industriell angeboten werden und somit zur Verfügung stehen, ist es äußerst vorteilhaft, als Trägerelemente beispielsweise Wafer-Scheiben zu verwenden, die eine hohe Oberflächenparallelität aufweisen und ebenfalls Oberflächenstrukturen, die eine unmittelbare Reflexionsbeeinflussung darauf auffallender Neutronen- und zumindest hochenergetischer Röntgenstrahlen faktisch ausschließen. Ferner werden die industriellen Bearbeitungstechnologien (z. B. Polieren) von Siliziumwafern beherrscht, so daß auch exakt planparallel polierte Siliziumwafer kostengünstig erhältich sind.

Als Monochromatorkristall eignen sich grundsätzlich alle Elemente, die ein ausreichend großes Reflexionsverhalten unter der Bragg'schen Reflexionsbedingung zeigen.

Insbesondere vorteilhaft ist es, als Monochromatorkristall 55 Graphit zu verwenden.

Um in Abhängigkeit der gewünschten Wellenlänge der Neutronen- und Röntgenstrahlen eine optimale Position der Monochromatorkristalle relativ zueinander einstellen zu können, da sich der Braggische Winkel mit der Wellenlänge ändert, ist es vorteilhaft, wenigstens einen Monochromatorkristall relativ zu dem anderen Monochromatorkristall zur Veränderung deren Abstandes voneinander verschiebbar auszubilden. Auf diese Weise ist es leicht möglich, die optimale Position der Monochromatorkristalle in Abhängigkeit der Wellenlänge einzustellen. Da es sich nur um eine parallele Verschiebung relativ zu den beiden planparallelen Oberflächen des Trägerelementes handelt und dabei keine Kippung bzw. Verstimmung der Monochromatorkristalle mit ih-

ren Reflexionsflächen aufeinander zu- bzw. voneinander weg handelt, ist eine derartige Verschiebbarkeit auch mit sehr einfachen technischen Mitteln bewirkbar.

Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf die nachfolgenden schematischen Zeichnungen anhand eines Ausführungsbeispieles im einzelnen beschrieben. Darin zeigen:

Fig. 1 in Form eines Blockaufbaus eine Draufsicht auf die Vorrichtung und

Fig. 2 ein gemessenes Transmissionsverhalten der Vorrichtung als Funktion des Einfallswinkels von auf die Vorlichtung gerichteter Neutronenstrahlen.

Es wird zunächst Bezug genommen auf die Darstellung gemäß Fig. 1. Die Vorrichtung 10 besteht bei der in der Figur dargestellten Ausführungsform aus einem für Neutronen- und Röntgenstrahlen 11, 14 durchlässigen Trägerele- 15 ment 15, das beispielsweise für Neutronen aus einem handelsüblich beziehbaren bzw. bereitstellbaren Silizium-Wafer bestehen kann, der eine hohe Planparallelität beider Oberflächen 150, 151 aufweist. Das Trägerelement 15 ist, bezogen auf die Darstellung der Fig. 1, um eine hier nicht gesondert 20 dargestellte Achse, die in Lotrichtung zur Grundplatte 17 ausgebildet ist, drehbar. Auf beiden Oberflächen 150, 151 des Trägerelementes 15 ist jeweils ein Monochromatorkristall 12, 13, der beispielsweise aus Graphit bestehen kann, angeordnet. Beide Monochromatorkristalle 12, 13 sind, bezogen auf deren jeweils gedachte Oberflächennormalen 152, 153, die in Lotrichtung auf die Oberflächen 150, 151 des Trägerelementes 15 ausgerichtet sind, voneinander beabstandet 16. Wenigstens einer der Monochromatorkristalle 12, 13 ist relativ zu dem anderen Monochromatorkristall 12, 30 13 über hier nicht dargestellte Verschiebungs- und Führungsmittel verschiebbar. Dadurch kann deren Abstand 16 voneinander, bezogen beispielsweise auf die schon erwähnten Oberflächennormalen 152, 153, verändert werden. Dieses ist für bestimmte Fälle erforderlich. Die Veränderung der 35 Wellenlängen der Neutronen- und Röntgenstrahlen 12, 13 haben eine Veränderung der Braggwinkel zur Folge. Durch die Veränderung kann somit dieser veränderten Wellenlänge durch Veränderung der Position der Monochromatorkristalle 12, 13 Rechnung getragen werden.

Zum Betrieb der Vorrichtung 10 werden von einer Neutronen- bzw. Röntgenquelle (nicht dargestellt) kommende Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 11 auf einen geeigneten Einfallwinkel zwischen Oberfläche 150, 151 des Trägerelementes 15 bzw. den darauf flächenparallel angeordneten 45 Monochromatorkristall 12 gedreht. Am Monochromatorkristall 12 werden die darauf einfallenden Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 11 reflektiert und auf den zweiten Monochromatorkristall 13 gerichtet, von wo die Neutronen- und Röntgenstrahlen wiederum unter Bragg-Bedingungen re- 50 flektiert und als reflektierte Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 14 aus der Vorrichtung 10 im wesentlichen in der gleichen Richtung wie die auf die Vorrichtung gerichteten eintretenden Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 11 austreten. Durch Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 55 entfällt die bisher notwendige aufwendige Justiervorrichtung, die bei den bisherigen Doppelkristallmonochromatoren zur Parallelisierung der Netzebenen der beiden Monochromatorkristalle notwendig war. So ist jetzt nur noch eine Richtung, die Richtung des gesamten Doppelkristallmono- 60 chromators zum Neutronen- oder Röntgenstrahl zu justie-

Im Fall des Doppelkristallmonochromators müssen zusätzlich die Netzebenen bzw. Kristalloberflächen der beiden Monochromatorkristalle hochgenau parallel zueinander justiert werden. Die physikalischen Mechanismen der Monochromatisierung einer Reflexion am Kristallgitter unter Bragg-Bedingungen sind der Fachwelt ansonsten bekannt

und brauchen hier nicht weiter erörtert zu werden.

Vorzugsweise werden die auf die Vorrichtung 10 gerichteten Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 11 mittels eines Kollimators 18 im Strahlquerschnitt begrenzt, was ebenfalls bezüglich der reflektierten Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 14 mittels eines zweiten Kollimators 19 geschehen kann. Der Kollimator kann als Strahlabsorber ausgebildet sein.

Der Werkstoff des Trägerelementes 15, beispielsweise in Form eines Halbleiterwerkstoffs, ist derart ausgewählt, daß eine werkstoffbedingte Dämpfung der Durchtrittsintensität der Neutronen- bzw. Röntgenstrahlen 11 vernachlässigbar klein ist.

Mittels eines Versuches wurde die Funktionsfähigkeit der Vorrichtung 10 in bezug auf das Transmissionsverhalten gegenüber bereits kollimierter und monochromatisierter Neutronenstrahlen bei einer Wellenlänge von 0,43 nm untersucht, und zwar als Funktion des Einfallswinkels. Es wurde dabei ein maximaler Transmissionsgrad von 25%, vergleiche Fig. 2, erhalten. Es ergab sich eine schmale Transmissionskurve entsprechend der Mosaikverteilung der Monochromatorkristalle 12, 13. Aus Fig. 2 ist der Winkel 2° ersichtlich, der dem optimalen Arbeitswinkel entspricht (Einfallswinkel des Neutronenstrahls 11 = Braggwinkel der Monochromatorkristalle 12, 13). Ein über die ermittelte maximale Transmission von 25% hinausgehender Wert war aufgrund der Art der verwendeten Monochromatorkristalle 12, 13 nicht möglich.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung

11 Neutronen- und Röntgenstrahlen (einfallend)

12 Monochromatorkristall

13 Monochromatorkristall

35 14 Neutronen- und Röntgenstrahlen (reflektiert)

15 Trägerelement

150 Oberfläche (Trägerelement)

151 Oberfläche (Trägerelement)

152 Oberflächennormale

10 153 Oberflächennormale

16 Abstand

17 Grundplatte

18 Kollimator

19 Kollimator

Patentansprüche

- 1. Vorrichtung zum Monochromatisieren von Neutronen- oder Röntgenstrahlen, umfassend wenigstens einen Monochromatorkristall, auf den die Neutronenoder Röntgenstrahlen gerichtet und nach der daran erfolgenden Reflexion als monochromatisierte Neutronen- oder Röntgenstrahlen abgegeben werden, dadurch gekennzeichnet, daß der Monochromatörkristall (12; 13) auf der Oberfläche (150; 151) eines planparallelen, für Neutronen- oder Röntgenstrahlen (11, 14) durchlässigen Trägerelementes (15) angeordnet ist. 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf beiden Oberflächen (150, 151) des Trägerelementes (15) jeweils ein Monochromatorkristall (12, 13) angeordnet ist, wobei beide Monochromatorkristalle (12, 13), bezogen auf deren jeweils gedachte Oberflächennormalen (152, 153), voneinander beabstandet sind.
- 3. Vorrichtung nach einem oder beiden der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (15) aus einem Halbleiterwerkstoff besteht.
- 4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-

zeichnet, daß der Halbleiterwerkstoff Silizium ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Halbleiterwerkstoff Germanium ist.
6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement aus einer Wafer-Scheibe herstellbar ist.

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Monochromatorkristall (12, 13) aus Graphit besteht.

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens
ein Monochromatorkristall (12; 13) relativ zu dem anderen Monochromatorkristall (12; 13) zur Veränderung
deren Abstandes (16) voneinander verschiebbar ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

20

5

30

35

40

45

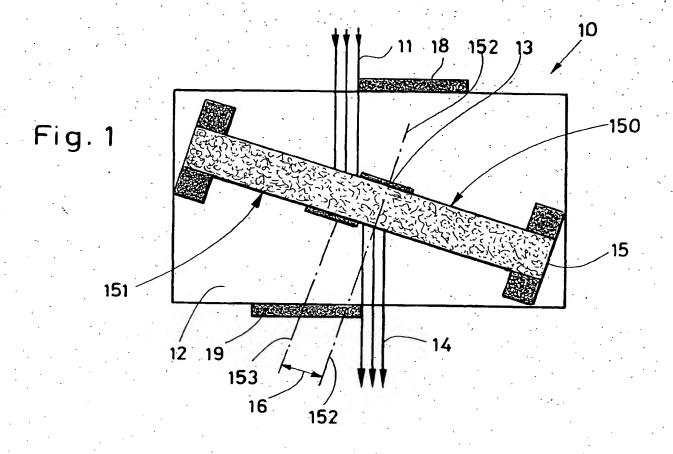
-

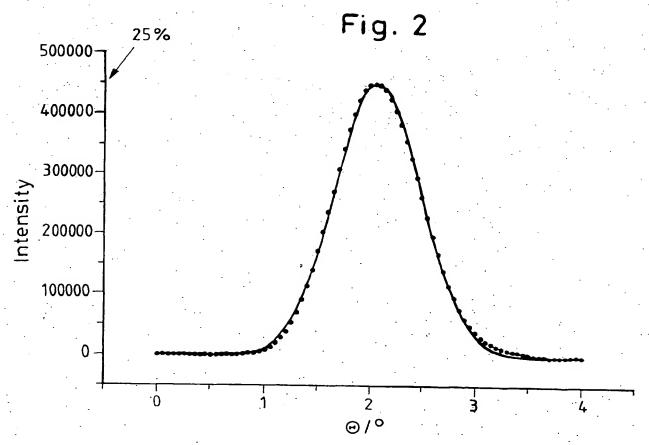
55

50

- Leerseite -

THIS PAGE BLANK (USPTO)





```
2/9/1
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.
             **Image available**
013807780
WPI Acc No: 2001-291992/*200131*
XRAM Acc No: C01-089719
XRPX Acc No: N01-208580
 Apparatus for monochromatizing neutrons or X-ray beams comprises a
 monochromator crystal arranged on the surface of a plane parallel support
 element that is permeable to neutrons and X-ray beams
Patent Assignee: GKSS FORSCHUNGSZENTRUM GEESTHACHT GMBH (KNVS )
Inventor: PANNEK M; SCHUBERT D W
Number of Countries: 001 Number of Patents: 002
Patent Family:
                     Date
                             Applicat No
Patent No
              Kind
                                            Kind
                                                   Date
                                                            Week
DE 19945773
              A1
                   20010412
                             DE 1045773
                                             A
                                                 19990924
                                                           200131
DE 19945773
               C2 20020207
                             DE 1045773
                                             А
                                                 19990924
                                                           200212
Priority Applications (No Type Date): DE 1045773 A 19990924
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                     Filing Notes
DE 19945773
                     5 G21K-001/06
             A1
DE 19945773
                       G21K-001/06
              C2
Abstract (Basic): *DE 19945773* A1
        NOVELTY - Apparatus comprises a monochromator crystal (12) on which
    neutrons or X-rays (11, 14) are directed and reflected as
    monochromatized neutrons or X-ray beams. The crystal is arranged on the
    surface (150) of a plane parallel support element (15) that is
    permeable to neutrons and X-ray beams.
        DETAILED DESCRIPTION - Preferred Features: The support element is
    made of a semiconductor material, preferably silicon or germanium, and
    is produced from a wafer. The crystal is made of graphite.
        USE - For monochromatizing neutrons or X-ray beams.
        ADVANTAGE - The apparatus has a simple design.
        DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a top view of the
    apparatus.
        neutrons or X-rays (11, 14)
        monochromator crystal (12)
        support element (15)
        surface of support element (150)
        pp; 5 DwgNo 1/2
Title Terms: APPARATUS; NEUTRON; RAY; BEAM; COMPRISE; MONOCHROMATOR;
  CRYSTAL; ARRANGE; SURFACE; PLANE; PARALLEL; SUPPORT; ELEMENT; PERMEABLE;
  NEUTRON; RAY; BEAM
```

....

Derwent Class: K08; V05

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): K08-E Manual Codes (EPI/S-X): V05-E08

International Patent Class (Main): G21K-001/06

THIS PAGE BLANK (USPTO)